日大生産工(院)¹, 日大生産工², 名大院工³, 名大 RCCME⁴ o守永 昂世¹ 飯田 和昌² 畑野 敬史³ 生田 博志^{3,4}

1. 緒言

銅酸化物超伝導体 $GdBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ (以下, GdBCOとする)は、超伝導転移温度Tcが約90K と高いため,実用化に向けた研究が精力的に行 われている、中でも、結晶構造を反映した物性 の異方性を調べることは、基礎・応用の両面に おいて重要である.基礎物性評価には、従来、 単結晶を用いて行われるのが一般的だが, GdBCOを含むREBCO(RE:希土類元素)は、c軸 方向に厚みを有する単結晶を作製するのが難 しい上,積層欠陥などが形成されやすい.その ため,異方性の評価には単結晶材料は不向きと 言える. そこで, c軸方向に厚みが少なく, こ れら欠陥が少ない薄膜を用いて異方性を評価 する方法が報告されている. 例えば, 薄膜の電 気抵抗の異方性は、Fig. 1に示すように[001]が [100]方向に傾斜したオフ基板の上に薄膜を成 長させ,調べられている¹⁾.しかし,基板のオ フ角αを系統的に変化させ、異方性を調べた報 告は少ない.

そこで、本研究ではGdBCO薄膜をオフ角α (0°,1.5°,3°,6°,10°)を有するSrTiO₃(001)基 板の上に成長させ、電気抵抗の異方性を調べた ので報告する.

2. 実験手法

GdBCO薄膜はKrFエキシマレーザーを用い たパルスレーザー堆積(PLD)法により成膜した. 成膜温度は $\alpha = 0^{\circ}$ (通常の基板)のみ790°Cで行 い、 $\alpha = 1.5^{\circ}$, 3°, 6°, 10°においては750°Cにて成 膜を行った.成膜雰囲気はいずれのオフ角でも $pO_2=40$ Paとした.成膜後、薄膜をチャンバー から取り出し、管状炉にて $pO_2=1$ atm下で



Fig. 1 Schematic illustration of (a) the vicinal cut and (b) the ordinary substrates, respectively.

400 ℃,3時間の酸素アニールを行い,酸素欠 損量δを減らした.その後,レーザーカッター を用いて*ab*面に平行な方向と,それに垂直な方 向に細線を加工し,電気輸送特性の評価を行っ た.なお,細線の長さと幅は両方向とも同じと した.

薄膜の不純物の有無,及び格子定数を調べるため,X線回折装置(rint2000,理学電気)を 用いた.X線源はCu-Kα(波長1.542Å)を用い, 測定範囲は0°≦2θ≦100°とした.

測定試料は、直流(DC)抵抗サンプルパック に固定した. ab面に平行な方向と、それに垂直 な方向の抵抗を同時に測定した. 磁場方位依存 性の測定には、バイアス電流が常に外部磁場に 垂直、すなわち最大ローレンツ力が細線に印加 されるように試料を固定した. 電気抵抗の温度 および磁場方位依存性は、東京大学物性研究所 にある物理測定システム PPMS(Quantum Design Japan)を用いて測定した.

3. 結果と議論

Figure 2にGdBCO薄膜のX線回折測定結果を 示す.また図中に、005反射の ω -scanから決定し たGdBCO薄膜のオフ角 β を示す.いずれの薄膜 も基板のオフ角と同程度であり、またc軸配向 しているのを確認した.



Fig. 2 X-ray diffraction spectrum of GdBCO grown on various SrTiO₃ having different offset angles α . The measured offset angles of GdBCO (i.e., β) are also shown.

Anisotropy of electrical resistance in copper oxide superconducting GdBa₂Cu₃O_{7-δ} thin films K Morinaga, K Iida,T Hatano and H Ikuta



Fig. 3 The temperature dependence of the *ab*plane and *c*-axis resistance for GdBa₂Cu₃O₇₋₈ grown on vicinal SrTiO₃ substrates with various β . The open and solid symbols represent R_c and R_{ab} , respectively.

Figure 3に β =0°, 1.55°, 3.23°, 6.05°, 10.74°の薄 膜の*ab*面に平行な方向と, それに垂直な方向の 抵抗(それぞれ, R_{ab} , R_T とする)から求めた*c*軸 方向の抵抗(R_c)の温度依存性を示す. なお, *c*軸方向の抵抗は $R_c = (R_T - R_{ab} \cos^2\beta) / \sin^2\beta$ を使 って求めた²⁾. いずれの薄膜も, ゼロ抵抗は 90~93 Kであった. また, 異方性を反映して R_{ab} < R_c であり, その差は約10³のオーダーであった.

Figure 4に β =1.55°, 3.23°, 6.05°, 10.74°の薄膜 の常伝導状態の抵抗の異方性y(= R_c/R_{ab})を示す. すべての試料は,温度が低下するにつれ, 異方 性yは増加した.また,オフ角が増大するにつれ て異方性も低下した.

Figure 5に β =6.05°, 10.74°, *T*=80 K, 86 Kの GdBCO薄膜の抵抗の磁場方位依存性を示す. ここで θ は,外部磁場*H*とGdBCOの*c*軸とのなす 角度である.すなわち, θ ~180°は*H*|*c*, θ ~90°と 270°は*H*||*ab*である. $\beta \le 6.05$ °,測定温度*T*=80 K では, θ ~180°で抵抗の落ち込みが観測された (Fig. 5a).これは,*c*軸に平行な磁束ピンの影響 による.一般に,PLD法で作製されたREBCO薄 膜には,螺旋転移が入ることが報告されている ³⁾.この螺旋転移が*c*軸相関ピンとして働く.こ の磁束ピンの影響は,*T*=86 Kで弱まり, θ ~180°



Fig. 4 The resistance anisotropy in the normal state for $GdBa_2Cu_3O_{7-\delta}$.



Fig. 5 The angular dependence of resistance for GdBa₂Cu₃O_{7- δ} grown on vicinal SrTiO₃ substrates with (a) β =6.05° at T = 80 K, (b) β =6.05° at T = 86 K, (c) β =10.74° at T = 80 K and (d) β =10.74° at T=86 K.

で観測された抵抗の減少が消失した(Fig. 5b). 一方, Fig. 5c, dに示すように β =10.74°の試料で は, c軸相関ピンの影響が小さいことがわかる. そこで, 異方的GLスケーリングモデル ($H_{eff} = H\sqrt{\cos^2\theta + \gamma_m^2 \sin^2\theta}$)⁴⁾を用いて,有効質量の 異方性 $\gamma_m (=\sqrt{m_c^2/m_{ab}^*})$ を求めた. Fig. 6に示すよ うに γ_m ~5で,全てのデータがスケールされる 様子がわかる.緩和時間が一定の場合,常伝導 状態における抵抗の異方性 γ は, $\gamma = m_c^2/m_{ab}^*$ な ので, $\gamma = \gamma_m^2 \sim 25$ となる.この値は,実験値で ある~100に比べて小さい.この原因として,積 層欠陥などによりc方向の抵抗が増大した可能 性が考えられる.

4. まとめ

銅酸化物超伝導体GdBCOの異方性を調べた. その結果,有効質量の異方性は約5程度で,常 伝導状態の抵抗の異方性から評価した値に比 べて小さかった.この原因の一つとして,積層



Fig. 6 The anisotropy of superconductivity for $GdBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ grown on vicinal $SrTiO_3$ substrates with β =10.74° at *T*=80 K.

欠陥などによりc方向の抵抗が増大したと考えられる.

参考文献

- 1) G. Heine *et al.*, *Nanomaterials* **11**, 675 (2021).
- 2) Th. Zahner *et al.*, *Physica* C **298**, 91 (1998).
- 3) B. Dam *et al.*, *Nature* **399**, 439 (1999).
- 4) G. Blatter *et al.*, *Phys. Rev. Lett.* **68**, 875 (1992).